

元智大學補助學生出席國際會議報告書

99年11月18日*

報告人姓名	蔡景元	所屬系所	化材所	職稱	博士班一年級
會議名稱	中文：第 32 屆乾式製程國際研討會				
	英文：32nd International Symposium on Dry Process				
會議時間	自 99 年 11 月 11 日 至 99 年 11 月	會議地點	日本東京工業大學		
	12 日				
論文發表	Low Temperature Deposition of SiO _x Films by HMDSN/O ₂ Atmospheric Pressure Plasma				

容應包括下列各項：

參加會議的經過

這次國際會議由日本東京之東京工業大學所舉辦的，其會議內容重點領域包含有本研討會已舉辦過31次其會議主要重點訴求在於乾式製程上之研究。乾式製程研發高性能微機械電子系統。其會議內容重點領域包含有電漿表面反應、電漿診斷、半導體&矽蝕刻、CVD/PVD/ALD、常壓電漿以及新乾式製程原理等，其研討會價值性在於國際間能互相商討以促進科學與科技領域上之新發展性。而研討會論文亦可轉投於國際知名期刊 Japanese Journal of Applied Physics，參加此研討會除了可讓學生吸收電漿與材料之相關知識以及使學生獲得與國際學者交流之機會。

二、 與會心得

學生我很高興能再次有這個機會參加在國外所舉行之國際研討會，並且能容性地獲得學校研發處的補助。讓我有足夠的旅費代表化材所電漿表面工程實驗室到日本東京工業大學與眾多國外學者進行學術交流。過去碩士曾經在國際研討會發表自我研究，現今以博士班身分參加此會議意義更加不一樣，過程中把過去辛苦的得到的數據整理而在許多國際間之名學者面前發表，相信一點一滴所獲取的經驗都是很寶貴的。

三、 考察參加活動（無此項活動者省略）

無

四、 建議

在於人生地不熟地方利用英語的溝通更是無價的，所以在學校間學習英文真的是很重要的。而且在現場發現不同學者所研究之領域皆近不同，所以希望學校多鼓勵研究所學生參與國際研討會能使學生學習更多寶貴經驗已經展現自我英文能力並擴展自身之國際觀。

五、 攜回資料名稱及內容

大會論文摘要集已經光碟。

六、 其他

